

# 解析的 寫真測定에 있어서 輕重率을 고려한 標定解析에 관한 研究

安 哲 浩\* 柳 福 模\*\*  
Ahn Chul-Ho Yeu Bock-Mo  
廉 在 洪\*\*\*  
Yom Jae-Hong

## 要 旨

工學의 여러 分野에 있어서 剩餘測定값은 최소제곱법으로 調整할 경우 觀測값의 輕重率을 고려하여 精度를 높일 수 있다.

本論文에서는 스트립座標를 Sequential 방법으로 형성하고 相互標定時 나타나는 回轉角  $\kappa, \varphi, \omega$ 의 크기에 반비례하여 각 모델에 輕重率을 부여하였다. 이 경우 輕重率을 고려한 絶對標定의 결과에 관하여 輕重率을 고려하지 않은 경우와 比較分析하였으며 絶對標定에 어떠한 影響을 미치는가를 고찰하였다.

## ABSTRACT

The method of least squares is an adequate method of adjustment in various fields of engineering where redundant observations are necessary to obtain accurate values.

The Consideration of weight of each Observation can improve the accuracy if the reliabilities of observations vary. The strip coordinates were weighted as inversely proportionate to the rotations  $\kappa, \varphi, \omega$  which occur in the computation of model coordinates. The resulting errors in absolute coordinates were compared with the errors unweighted case to investigate the influence of orientation elements on absolute coordinates.

## 1. 序 論

解析的 寫真測量의 여러 단계에서 임의의 座標값이 다른 座標값 보다 精密하지 못할 때 이들 좌표값에 輕重率을 부여하므로써 보다 정확한 絶對座標를 얻을 수 있다.

일반적으로 문제해석의 복잡성 또는 研究資料

의 부족으로 인하여 모든 좌표값이 같은 精度를 갖는 것으로 가정하고 계산되어 왔다. 内部標定相互標定 및 絶對標定에 있어서 輕重率을 바르게 부여할 수 있다면 오차를 감소시켜 보다 정확한 지상좌표를 구할 수 있다.

B. Hallet는 内部標定에 있어서 像座標의 輕重率을 조사하여 주점으로부터 멀어진 放射距離에 따라 輕重率을 다르게 주었으며 또한 相互標定에서는 각 점들의 y-視差의 크기와 반비례로 輕重率을 부여하면 誤差를 감소시킬 수 있다고 제안하였다.<sup>(1)</sup>

\*서울대학교 工科大學 教授  
\*\*延世大學校 工科大學 副教授  
\*\*\*延世大學校 工科大學院

航空寫眞 촬영 시 重直을 유지시키려는 많은 노력에도 불구하고 작은 tilt 가 발생하기 마련이다. 이 tilt 는 모델좌표를 계산할 때 사진의 回轉角  $\kappa, \varphi, \omega$ 로 나타나는데 이 회전각은 座標계 산에 미치는 영향이 크며 이로 인하여 발생하는 誤差를 감소시킬 수 있다면 보다 정확한 座標解析이 가능할 것이다.

本研究에서는 相互標定 당시 나타나는 사진의 回轉角  $\kappa, \varphi, \omega$ 의 逆數를 絶對標定에 이용되는 基準點의 輕重率로 간주하여 座標變換 이후에 발생하는 誤差를 조사하므로써 좌표해석의 精度를 높이는데 目的을 두고 있다.

1899년부터 1932년 사이에 發表된 여러 논문에서 Sebastian Finster Walder 는 解析的寫眞의 기초를 형성했다. 그는 相互標定, 絶對標定의 원리를 거론했으며 사진측량에 벡터의 개념을 사용하였다. Carl Pulfrich 는 1901년 Jena에서 최초의 精密座標測定機의 제작을 발표했으며 그후로 사진측량에 많은 발전이 있었다. 컴퓨터가 발전되면서 H. Schmid, D. Brown, C. Tewinkel(U.S.A)와 G. Schut(Canada)가 제시한 여러 수학적 업적들이 널리 실용화되었다.

解析的寫眞測量의 여러 방법이 개발되면서 誤差와 信賴度에 관한 많은 研究가 진행되었다. A.B. Sunter 는 삼각망에서 角의 輕重率과 觀測값의 조정에 관하여 연구했으면 biased 된 관측값에 대한 최소제곱법의 調整에 관해서도 발표했다. <sup>(2), (3)</sup> 화란의 I.T.C.에서는 P. Stefanovic, M. Molenaar, T. Boulcous, F. Amer 등에 의해 信賴度에 관한 여러편의 論文이 발표되었다. <sup>(4), (5), (6), (7)</sup> 또한 G. Schut 는 B. Hallert 가 연구한 결과를 이용하여 상호표정에서 사진좌표에 輕重率을 부여하는 과정을 프로그램하였다.

## 2. 標定解析理論

### 2.1 分산—공분산의 전파

誤差가 포함된 관측치를 사용하여 계산할 때 그 오차가 결과값에 미치는 영향에 대해서는 관측값들의 분산—공분산의 전파에 관해서 分析하므로써 알 수 있다. <sup>(8)</sup>

確率變數  $X_1, X_2 \dots X_m$  이 uncorrelate 된 것으로 가정 하던 분산—공분산 매트릭스  $\Sigma_{xx}$ 의 off-diagonal 項들은 0 이 되어 분산만 있는 diagonal 매트릭스로 된다. 분산—공분산 매트릭스와 輕重率매트릭스의 관계는 다음과 같다.

$$W_{xx} = \sigma_0^2 \Sigma_{xx}^{-1} \quad (1)$$

여기서  $\sigma_0^2$  은 reference 분산이다.  
확률변수 벡터를 다음 선형식으로 나타낼 때

$$y = Ax + b \quad (2)$$

$y$ 의 분산—공분산 매트릭스는

$$\Sigma_{yy} = A \cdot \Sigma_{xx} A^t \quad (3)$$

이다.

비선형함수를 선형화하였을 때  $y$ 에 전파되는 분산—공분산매트릭스는

$$\Sigma_{yy} = J_{yx} \cdot \Sigma_{xx} \cdot J_{yx}^t \quad (4)$$

이다. 여기서  $J_{yx}$  는 Jacobian 매트릭스이다.

Cofactor 매트릭스를  $Q_{xx}$  라 하면

$$\begin{aligned} \Sigma_{xx} &= \sigma_0^2 Q_{xx} \\ \Sigma_{yy} &= \sigma_0^2 Q_{yy} \end{aligned} \quad (5)$$

이며, (5)식을 (3), (4)식에 代入하면

$$\begin{aligned} Q_{yy} &= A \cdot Q_{xx} \cdot A^t \quad (\text{선형일 경우}) \\ Q_{yy} &= J_{yx} Q_{xx} J_{yx}^t \quad (\text{비선형일 경우}) \end{aligned} \quad (6)$$

최소제곱법으로 調整할 때 관측값을 다음 매트릭스방정식으로 나타낼 수 있다.

$$V + B \cdot A = f \quad (7)$$

여기서  $V$ 는 残差의 벡터,  $A$ 는 매개변수 벡터,  $B$ 는 매개변수의 계수로 이루어진 매트릭스이다.

$l, d$  를 각자 觀測값과 상수들의 벡터라 놓으면  $f$ 는 다음과 같다.

$$f = d - l \quad (8)$$

觀測差의 Cofactor 매트릭스와 輕重率매트릭스를 각각  $Q, W$ 로 놓고 (8)식을 (2)식과 같은 형태로 나타내면 다음과 같이 되며

$$f = (-I) \cdot l + d \quad (9)$$

(6)식을 적용하면 다음과 같이 된다.

$$Q_{ff} = (-I) \cdot Q \cdot (-I)^t = Q \quad (10)$$

(10)식에서  $l$ 의 Cofactor 매트릭스와  $f$ 의 Cofactor 매트릭스는 같다는 것을 알 수 있다.

최소제곱법의 각 단계를 매트릭스로 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} N &= B^t W \cdot B \\ t &= B^t W \cdot f \\ \Delta &= N^{-1} \cdot t \\ V &= f - B\Delta \\ \hat{l} &= l + V \end{aligned} \quad (11)$$

여기서  $N$ 은 Normal 방정식의 계수매트릭스이며  $\hat{l}$ 은 보정된 관측값이다. (11)식을 (2)식과 같은 형태로 나타내면

$$\begin{aligned} t &= (B^t W) \cdot f \\ \Delta &= (N^{-1})t \\ V &= (I - BN^{-1}W)f \\ \hat{l} &= (-B)\Delta + d \end{aligned} \quad (12)$$

이다.

Cofactor의 전파 원리를 (13)식에 대입하면 (13)식의 괄호 안의 항은 (4)식의  $A$ 에 해당되므로

$$\begin{aligned} Q_{tt} &= (B^t W)Q_{ff}(B^t W)^t = N \\ Q_{\Delta\Delta} &= (N^{-1})Q_{tt}(N^{-1})^t = N^{-1} \\ Q_{vv} &= (I - BN^{-1}B^t W)Q_{ff}(I - BN^{-1}B^t W)^t \\ &= Q - BN^{-1}B^t \\ Q_{l\hat{l}} &= BN^{-1}B^t \end{aligned}$$

가 된다.

여기서  $Q_{vv}$ 와  $Q_{tt}$ 에 대한 식으로부터 다음식을 구할 수 있다.

$$Q_{l\hat{l}} = Q - Q_{vv} \quad (14)$$

$t, \Delta, V$ 와  $\hat{l}$ 에 대한 공분산 매트릭스는 각 Cofactor 매트릭스에  $\sigma_0^2$ 를 곱하면 구할 수 있다.

## 2.2 輕重率을 고려한 標定

本研究에서 絶對標定의 프로그래밍은 PAT-M43에서 사용되는 planimetry-height iteration으로 하였다. 이 방법은 精度와 收斂速度 면에서는 7개의 변수를 직접 결정하는 방법과 대등하나 다음과 같은 장점이 있다. 첫째, 평면의 iteration 과정은 선형이므로 초기 근사값이 필요 없다. 둘째, 7열의 매트릭스를 푸는 대신 4열과 3열의 매트릭스를 푸는 방법이므로 계산시간이 단축된다. 세째, 두 단계로 분리시켜 조정

하므로 輕重率을 고려하기가 편리하다.

### 2.2.1 平面매개변수 결정

$x, y$  축 방향을 같은 缩尺으로 가정하고 두 축이 直交하는 것으로 가정하면 매개변수 解에 관한 좌표변환식이 된다.

$$\begin{aligned} X &= a_0 + ax + by \\ Y &= b_0 - bx + ay \end{aligned} \quad (15)$$

이를 이용하여 평면에 대한 觀測方程式을 세우면

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 & 0 \\ y & -x & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ a_0 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} \quad (16)$$

이 되며 다음과 같이 表現示한다.

$$A \cdot P = C$$

normal 방정식은

$$P = (A^t W_p \cdot A)^{-1} \cdot (A^t \cdot W_p \cdot C) \quad (17)$$

이다. 여기서  $W_p$ 는 平面基準點에 대한 輕重率 매트릭스로서 점들 사이의 상호공분산이 없는 것으로 제한하였기 때문에 diagonal 매트릭스가 된다. 관측방정식과 경중율매트릭스를 이용하여 normal 방정식을 전개한 매트릭스는 다음과 같아 된다.

$$\begin{vmatrix} \sum W_{pi}(x_i^2 + y_i^2) & 0 & \sum W_{pi}x_i & \sum W_{pi}y_i \\ 0 & \sum W_{pi}(x_i^2 + y_i^2) & \sum W_{pi}y_i - \sum W_{pi}x_i & \sum W_{pi} \\ \sum W_{pi}x_i & \sum W_{pi}y_i - \sum W_{pi}x_i & \sum W_{pi} & 0 \\ 0 & \sum W_{pi} & 0 & \sum W_{pi} \end{vmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{vmatrix} a \\ b \\ a_0 \\ b_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum W_{pi}(x_i X_i + y_i Y_i) \\ \sum W_{pi}(y_i X_i - x_i X_i) \\ \sum W_{pi}X_i \\ \sum W_{pi}Y_i \end{vmatrix}$$

### 2.2.2 높이 대개변수 결정

높이 座標變換式에 대한 관측방정식은 다음과 같이 표시된다.

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \\ c_0 \end{bmatrix} = [Z/\lambda - z] \quad (\rightarrow)$$

$$B \cdot P = F$$

평면의 경우에서와 같이 normal 방정식은

$$P = (B^t \cdot W_H \cdot B)^{-1} \cdot (B^t \cdot W_H \cdot F) \quad (20)$$

이다. 이때의 경중율 매트릭스는

$$W_{Hi} = \begin{bmatrix} W_{H1} & & \\ & W_{H2} & \\ & & \ddots \\ & & & W_{Hi} \end{bmatrix}$$

로써 전개된 normal 방정식의 매트릭스는 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \sum W_{Hi} X_i^2 & -\sum W_{Hi} x_i y_i & -\sum W_{Hi} x_i \\ \sum W_{Hi} y_i^2 & \sum W_{Hi} y_i & \sum W_{Hi} \\ c \\ d \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sum W_{Hi} x_i \Delta Z_i \\ \sum W_{Hi} y_i \Delta Z_i \\ \sum W_{Hi} \Delta Z_i \end{bmatrix} \quad (21)$$

여기서  $\Delta Z_i = Z_i - z_i$ 이다.

평면座標와 높이座標의相互作用이 있으므로 얻은 결과값을 iteration 시켜야 하는데 새로 계산된 값을 모델좌표로 사용하여 축척이 1에 접근할 때까지 처음부터 계산을 반복한다.

### 3. 觀測 간 處理分析

#### 3.1 觀測 간處理

실험모델로서 摄影高度가 1215 m인 6 장의 사진을 이용했으며 40 개의 표정점에 대한 index map 은 다음과 같다.

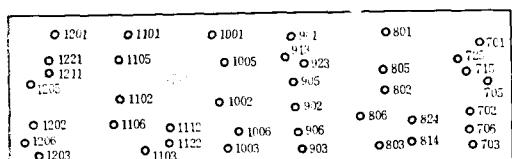


그림 3-1 標定點들의 index map

基準點의 배치를 변화시키면서 기준점수를 4에서 12 까지 2 쪽 증가시켰으며 輕重率을 고려하지 않는 경우와  $k$ ,  $\varphi$ ,  $\omega$ 에 대해서 고려한 경우를 비교하였다. 일반적으로 기준점들이 등간격으로 분포되어 있어야 하며 strip의 모서리와 가장자리에 있어야 높은 精度를 얻을 수 있다.<sup>(9)</sup> 제 1 분포는 이와같이 등간격으로 가장자리의 점들을 基準點으로 택하였으며 strip의 중앙에 기준점이 있는 경우를 조사하기 위하여 제 2 분포를 형성하였다. 또한 일정한 규칙성이 없이 선점하여 제 3 분포에 대해서도 조사하였다.

基準點의 分布를 그림으로 나타냈으며 각 분포에 대해서 조사한 絶對座標 誤差를 표로 나타냈으며 이를 평면과 높이로 구분하여 그래프로 나타냈다. 전체표정점들의 절대좌표오차는 다음식을 사용하여 계산하였다.<sup>(10)</sup>

$$\sigma = \left[ \frac{\sum (\Delta x_i)^2}{n} \right]^{1/2}$$

이때  $\Delta x_i$ 는 지상성과와 계산된 座標값의 残差이며  $n$ 은 표정점수이다.

#### 3.2 觀測 간 分析

本研究에서 考察한 觀測 간을 算定하여 分析한 成果는 다음과 같다.

제 1 분포

○ 1	○ 9	○ 6	○ 11	○ 3	○ 8
○ 5	○ 2	○ 10	○ 7	○ 12	○ 4

그림 4-2 基準點의 제 1 분포

표 4-1 제 1 분포에 대한 絶對座標의 RMS(m)

평면 경중율	기준점수 높이	4	6	8	10	12
		평면	.4025	.4007	.3730	.3792
unweighted	평면	.4228	.4228	.3980	.3926	.3931
	높이	.3937	.4095	.3875	.3921	.3981
$\kappa$ -weighted	평면	.4222	.4317	.4063	.4034	.4090
	높이	.3937	.4095	.3875	.3921	.3981
$\varphi$ -weighted	평면	.3944	.4009	.3874	.3866	.3824
	높이	.3995	.4164	.3919	.3846	.3848
$\omega$ -weighted	평면	.4135	.4370	.3945	.3972	.3998
	높이	.4063	.4084	.3950	.3966	.4227

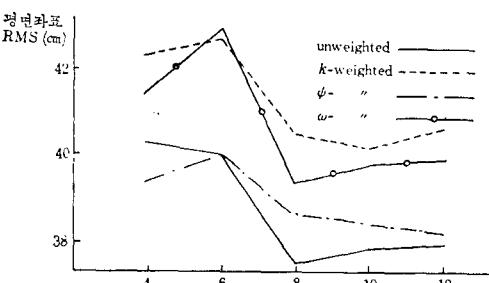


그림 4-3 제 1 분포의 평면좌표 RMS

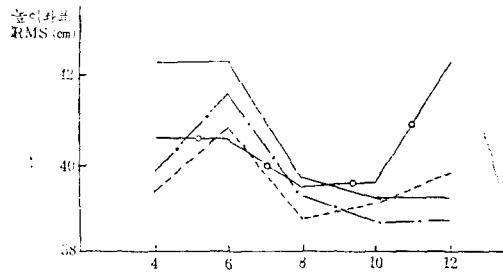


그림 4-4 제 1 분포의 높이차표 RMS

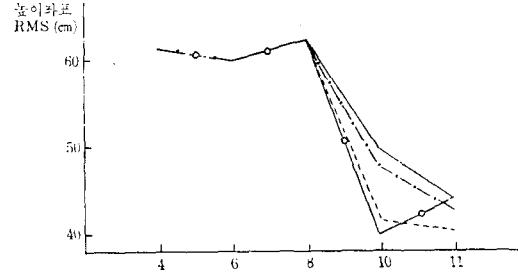


그림 4-7 제 2 분포의 높이차표 RMS

제 2 분포

○1	○9	○3
○5	○11	○6
○7	○12	○8
○2	○10	○4

그림 4-5 기준점의 제 2 분포

제 3 분포

○1	○5	○7	○3
○9	○7	○8	○10
○2	○12	○6	○4

그림 4-8 기준점들의 제 3 분포

표 4-2 제 2 분포에 대한 절대좌표의 RMS(m)

평면		기준점수	4	6	8	10	12
경중율	높이						
unweighted	평면	.3667	.3644	.3676	.3632	.3617	
	높이	.6102	.6055	.6288	.4990	.4331	
$\kappa$ -weighted	평면	.3738	.3658	.3682	.3616	.3635	
	높이	.6103	.6062	.6294	.4115	.4030	
$\varphi$ -weighted	평면	.3690	.3643	.3673	.3620	.3606	
	높이	.6102	.6059	.6292	.4823	.4207	
$\omega$ -weighted	평면	.3777	.3672	.3692	.3653	.3715	
	높이	.6103	.6063	.6295	.4025	.4341	

표 4-3 제 3 분포에 대한 절대좌표의 RMS(m)

평면		기준점수	4	6	8	10	12				
경중율	높이			평면	RMS	6	8	10	12		
		unweighted			.3667	.3677	.3638	.3634	.3657		
$\kappa$ -weighted	평면			.6102	.4259	.4022	.4322	.4097			
	높이					.3738	.3786	.3676	.3624	.3821	
$\varphi$ -weighted	평면					.6103	.3973	.3930	.3984	.3933	
	높이						.3690	.3668	.3623	.3623	.3701
$\omega$ -weighted	평면						.6102	.4132	.3930	.4139	.3977
	높이							.3777	.3967	.3842	.3678

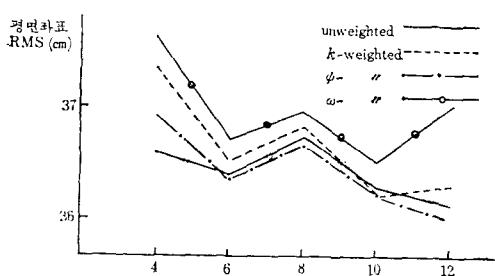


그림 4-6 제 2 분포의 평면좌표 RMS

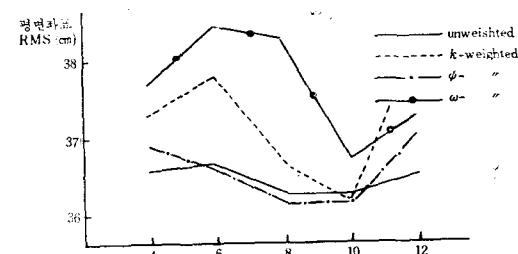


그림 4-9 제 3 분포의 평면좌표

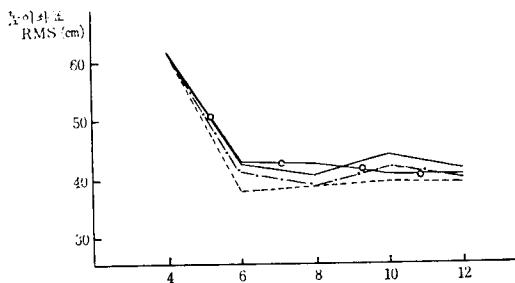


그림 4-10 제 3 분포의 높이좌표 RMS

輕重率을 고려한 경우와 고려하지 않은 경우의 비교를 誤差의 증감으로 표시하여 백분율로 나타다면 다음표와 같다.

표 4-4 높이좌표 오차의 증감 %(( )안의 값은 증가)  
제 1 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		6.8	3.1	2.6	0.1	(1.2)
$\varphi$		5.5	1.5	1.5	2.0	2.1
$\omega$		3.9	3.4	0.7	(1.0)	(7.5)

제 2 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		(0.0)	(0.1)	(0.0)	17.5	6.9
$\varphi$		0.0	(0.0)	(0.0)	3.3	2.8
$\omega$		(0.0)	(0.1)	(0.1)	19.3	(0.2)

제 3 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		(0.0)	6.7	2.2	7.8	4.0
$\varphi$		0.0	2.9	2.2	4.2	2.9
$\omega$		(0.0)	(0.2)	(4.3)	(5.6)	1.0

표 4-5 평면좌표 오차의 증감 (%) (( )속은 증감)  
제 1 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		(4.8)	(7.7)	(8.9)	(6.3)	(7.6)
$\varphi$		2.0	(0.0)	(3.8)	(1.9)	(0.6)
$\omega$		(2.7)	(9.9)	(5.7)	(4.7)	(5.2)

제 2 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		(1.9)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.4)
$\varphi$		(0.6)	0.0	0.0	0.3	0.3
$\omega$		(2.9)	(0.7)	(0.4)	(0.5)	(2.7)

제 3 분포

회전자	기준점수	4	6	8	10	12
$\kappa$		(1.9)	(2.9)	(1.0)	0.2	(4.6)
$\varphi$		(0.6)	0.2	0.4	0.3	(1.3)
$\omega$		(2.9)	(7.8)	(5.6)	(1.2)	(2.5)

높이좌표에서  $\phi$ 에 대해서 輕重率을 부여하므로써 제 1 분포에서는 5.5%까지의 오차를 감소시켰으며  $\kappa$ 에 대해서도 제 2 분포에서 최대 5.5%까지 감소시킬 수 있었다.  $\omega$ 에 대해서 輕重率을 부여하였던 바 제 2 분포에서 19.3%까지 감소시켰으나 그 이외의 경우는 誤差의 증가를 보였다. 基準點分布에 따른 誤差의 감소를 조사하면 높이 좌표에서는 스트립의 모서리와 가장자리에 基準點이 분포된 제 1 분포에서 誤差가 가장 작았다. 平面座標에서는 스트립의 중앙부분에 基準점이 있는 제 2 분포에서 가장 양호하였다.

이것은 기준점의 분포와 좌표값의 輕重率이 밀접한 관계가 있는 것을 나타내며 基準點의分布가 좋을 때 輕重率에 의한 誤差의 감소가 效果적인 것을 의미한다.

#### 4. 結論

相互標定 당시 나타나는 사진의 回轉角에 대한 輕重率을 부여하여 絶對座標의 誤差를 分析하므로써 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 높이좌표에서  $y$  축의 回轉角인  $\phi$ 에 대하여 輕重率을 부여한 결과 전체 誤差의 5.5%까지 감소시킬 수 있었으며  $Z$  축의 回轉角인  $\kappa$ 에 대해서 부여한 결과 최대 17.5%까지 감소시킬 수 있었다.
2. 平面座標에서 誤差 감소에 미치는 영향은 回轉角에 부여한 輕重率의 영향보다 基準點의 分布상태가 지배적이다.
3. 基準點이 스트립의 중앙부분에 있을 때 平面

座標의 誤差를 감소시켰으며 스트립의 모서리와 가장자리에 있을 때 높이좌표의 오차를 差果的으로 감소시킬 수 있었다.

### 参考文献

1. Hallert, B., "Investigation of the Weights of Image Coordinates in Aerial Photographs", Photogrammetric Engineering, Vol. 27, No. 4, 1961, pp.555~565.
2. Sunter, A.B., "Treatment of Observations: Rejection and Weights", Canadian Surveyor, Vol.15, No. 8, 1961, pp.454~460.
3. Sunter, A.B., "Least Squares Adjustment of Biased Observations", Canadian Surveyor, Vol.21, No. 4, 1967, pp.318~333.
4. Stefanovic, P., "Blunders and Least Squares", ITC Journal, 1978-1, pp.122~155.
5. Molenaar, M., "Risk Minimisation for Error Detection Procedures in photogrammetry", ITC Journal, 1981-2, pp.185~201.
6. Boulocos, T., "Error Detection and Reliability Studies in Analytically Formed Strips", ITC Journal, 1981-1, pp.60~69.
7. Amer, F., "Theoretical Reliability of Elementary photogrammetric Procedures", ITC Journal, 1981-3, pp.278~306.
8. Mikhail, E.M., Analysis and Adjustment of Survey Measurements, Vanstrand Reinhold Company, N.Y., 1981, pp.148~172.
9. A.S.P., Manual of Photogrammetry 4thed., 1980, pp.471~476.
10. Ghosh, S.K., Analytical Photogrammetry, Pergamon Press, N.Y., 1979, pp.119~130.